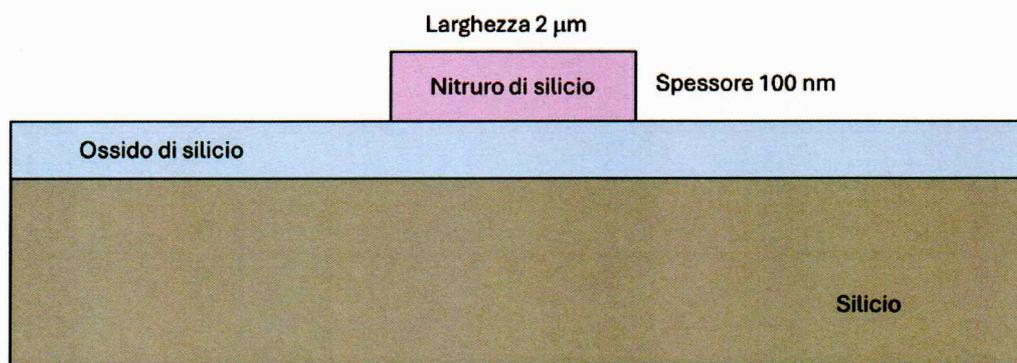


BANDO N. 1/2024/TD/CTER- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 36 (trentasei) mesi, di n. 2 unità di personale di VI livello, profilo professionale Collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER)

TRACCIA N. 1

Si consideri la struttura rappresentata qui sotto in sezione. Le componenti della sezione NON sono in scala.

1. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica litografica che può essere utilizzata per ottenere la struttura dello strato in nitruro di silicio. Le dimensioni della struttura sono: larghezza $2\ \mu\text{m}$, lunghezza $200\ \mu\text{m}$ (non mostrata in sezione).
2. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica di deposizione dello strato in nitruro di silicio che deve avere uno spessore di $100\ \text{nm}$.
3. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica di etching per ottenere la struttura di nitruro di silicio.
4. Descrivere, giustificando la scelta, la tecnica o le tecniche di caratterizzazione per verificare che l'etching ottenuto corrisponda alla struttura desiderata.



CF RL en